

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE ALINEADORA DE MÁSCARAS PARA SISTEMA DE FOTOLITOGRAFÍA ÓPTICA

El equipamiento solicitado consiste en una alineadora de máscaras para un sistema de fotolitografía óptica. El equipo está destinado a la transferencia de patrones desde máscaras a sustratos diversos (silicio, cuarzo, cerámicos, etc.) con aplicación a la realización de circuitos de microondas y onda milimétrica, así como a la fabricación de dispositivos RF MEMS (Radio Frequency MicroElectroMechanical Systems).

A continuación se detallan las características técnicas mínimas que debe reunir el equipo objeto de la presente licitación:

- Capacidad de albergar máscaras de 2" x 2" hasta 5" x 5" pulgadas
- Capacidad de albergar sustratos de hasta 100 x 100 mm
- Etapa X,Y, θ con tornillos micrométricos para alineamiento entre máscara y sustrato con resolución sub-micrométrica
- Modo de exposición de contacto y opcionalmente en vacío
- Capacidad para integración de óptica UV400
- Resolución de línea/espaciado inferior a 1 micrómetro
- Microscopio óptico de alta resolución
- Mesa antivibratoria
- Mínimo 1 año de garantía

Se valorará la capacidad de actualización y mejora futura del equipo.

Valencia, 28 de septiembre de 2011



Firmado: Vicente E. Boria Esbert
Catedrático de Universidad

E-mail: yboria@com.upv.es (Ext. 79718)

Grupo de Aplicaciones de Microondas

iTEAM, Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia